

# 酸化物半導体討論会 開催のお知らせ

2015年4月16日

東京工業大学 応用セラミックス研究所  
神谷 利夫

## 関係者各位

標記討論会を、別紙要領で行います。

本討論会ですが、成果の公表ではなく、講演者が話題を提供し、講演者および聴講者が議論・情報交換することを目的としております。そのため、聴講される方も、積極的に議論に加わっていただくこと、場合によっては、講演者から聴講者に質問されることなどもあることをご承知の上、ご参加ください。

また、本討論会の聴講は、事前に下記要領でお申込みいただいた方に限らせていただきます。お申込みいただいた場合も、開催者側の判断で聴講をお断りする場合がございますので、ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。

以上

**会議名** : 酸化物半導体討論会

**開催日時**: 平成 27 年 5 月 18 日(月) 10:00~17:30 頃

**開催場所**: 東工大すずかけ台キャンパス 元素戦略棟 1F会議場

変更の可能性がございますので、参加登録いただいた方には、  
開催日前にメールでご連絡いたします。

**聴講資格**: 下記手順にて、2015年5月13日までにお申し込み下さい。

参加者多数の場合、上記期日以前に締め切らせていただく場合があります。

**参加費**: 無料

## 参加申し込みの方法:

1. <http://conf.msl.titech.ac.jp/cgi-bin/Oxide2015.pl?Action=NoLogonRegistration>  
にアクセスし、フォームにご記入の上、「登録: 確認ページへ」ボタンを押してください
2. 確認ページが表示されますので、間違いがなければ、「登録」ボタンを押してください。
3. ご登録いただいた EMail アドレスに、登録完了の確認メールが届きます。

以上で参加登録は完了していますので、当日はお名前と登録番号を受付にてお伝えください。

予定にご変更等あります場合は、神谷利夫 ([tkamiya@msl.titech.ac.jp](mailto:tkamiya@msl.titech.ac.jp)) までご連絡ください。

# 酸化物半導体討論会プログラム

注：講演時間はあくまでも参考です。

進行により大きく前後する場合がございますので、予めご承知ください。

1. 日時：平成 27 年 5 月 18 日(月) 10:00~17:30 頃
2. 場所：東工大すずかけ台キャンパス 元素戦略棟 1F 会議場(変更の可能性あり)
3. プログラム (講演時間は、あくまでも目安です)
  - 1) 10:00~10:05 「はじめに」 神谷 利夫 (東工大)
  - 2) 10:05~10:35 「酸化物中の欠陥 (仮)」:  
神谷 利夫、雲見日出也、細野秀雄 (東工大) (30 分)
  - 3) 10:45~11:10 「アモルファス IZO,IGZO の結晶化挙動 (仮)」  
重里 有三、賈 軍軍、須古 彩香 (青山学院大学) (25 分、)
  - 4) 11:20~11:40 「酸化物半導体の酸素による欠陥準位」  
井手 啓介、神谷 利夫、雲見日出也、細野秀雄 (東工大) (20 分)
  - 5) 11:50~12:15 「新規酸化物半導体 TFT の形成及び評価」  
松田 時宜、木村 睦 (龍谷大学) (25 分)
  - 12:15~13:30 昼食
  - 6) 13:30~14:00 「フッ素による IGZO 薄膜トランジスタの欠陥終端と信頼性改善効果」  
古田 守、Jingxin JIANG、王 大鵬 (高知工科大学) (30 分)
  - 7) 14:10~14:40 「酸化物半導体 TFT の信頼性向上技術」  
浦岡 行治 (奈良先端科学技術大学院大学) (30 分)
  - 8) 14:50~15:10 「AOS 分析から見えてくること (仮)」  
井上 敬子 ((株)東レリサーチセンター) (20 分)
  - 15:10~15:40 休憩
  - 9) 15:40~16:00 「プラズマ支援反応性スパッタ製膜プロセスによる IGZO 薄膜デバイス低温形成」  
節原裕一、陶山悠太郎、中田 慶太郎、竹中弘祐、内田 儀 一郎、江部明憲\*  
(大阪大学接合科学研究所、\* 株式会社イー・エム・ディー) (20 分)
  - 10)16:10~16:30 「大型スパッタカソードにおける IGZO 膜の均一性向上」  
小林 大士 (株式会社アルバック) (20 分)
  - 11)16:40~17:05 「AOS デバイスの新規回路・アプリケーション応用」  
木村 睦 (龍谷大学) (25 分)
  - 12)17:05~17:30 「総合討論」 総合司会：神谷 利夫 (東工大)

以上